

T1/5/ALL

1/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013235203

WPI Acc No: 2000-407077/200035

Related WPI Acc No: 2000-407076; 2000-407078

XRAM Acc No: C00-123525

Pack cosmetics for use as skin moisturizer contains thin film forming high molecular compound and moisturizer maintained under specified conditions

Patent Assignee: KAO CORP (KAOS)

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2000143477	A	20000523	JP 98312391	A	19981102	200035 B
TW 513316	A	20021211	TW 99118958	A	19991101	200353
JP 3455120	B2	20031014	JP 98312391	A	19981102	200369

Priority Applications (No Type Date): JP 98312391 A 19981102; JP 98312390 A 19981102; JP 98312392 A 19981102

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2000143477	A		6	A61K-007/48	
TW 513316	A			A61K-007/48	
JP 3455120	B2		5	A61K-007/48	Previous Publ. patent JP 2000143477

Abstract (Basic): JP 2000143477 A

NOVELTY - Pack cosmetics contain thin film forming high molecular compound whose water retention is 15% or more and a moisturizer which are mixed with water and maintained at 25degreesC and 50% relative humidity for 64 hours.

USE - For use as skin moisturizer.

ADVANTAGE - The pack cosmetics when applied on the skin does not affect the skin. The skin cosmetic has high and continuous moisture

keeping effect.

pp; 6 DwgNo 0/0

Title Terms: PACK; COSMETIC; SKIN; MOISTURISE; CONTAIN; THIN; FILM; FORMING
; HIGH; MOLECULAR; COMPOUND; MOISTURISE; MAINTAIN; SPECIFIED; CONDITION

Derwent Class: A14; A96; D21

International Patent Class (Main): A61K-007/48

International Patent Class (Additional): A61K-007/00

File Segment: CPI

?

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-143477

(P2000-143477A)

(43) 公開日 平成12年5月23日 (2000.5.23)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード (参考)

A 6 1 K 7/48

A 6 1 K 7/48

4 C 0 8 3

7/00

7/00

U

J

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平10-312391

(71) 出願人 000000918

花王株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

(22) 出願日

平成10年11月2日 (1998.11.2)

(72) 発明者 長澤 真木

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社
社研究所内

(72) 発明者 佐野 友彦

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社
社研究所内

(74) 代理人 100068700

弁理士 有賀 三幸 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 パック化粧料

(57) 【要約】 (修正有)

【解決手段】 (A) 水中に1重量%配合した液を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上であるカルボキシビニルポリマーカラギーナン等の被膜形成性高分子化合物、及び(B) 保湿剤を含有するパック化粧料。

【効果】 使用中のわずらわしさがなく、肌に水分を持続的に与え、高い保湿効果が得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 水中に1重量%配合した液を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上である被膜形成性高分子化合物、及び(B)保湿剤を含有するバック化粧料。

【請求項2】 成分(A)が、カルボキシビニルポリマー及びカラギーナンを含むものである請求項1記載のバック化粧料。

【請求項3】 (A) 水中に1重量%配合した液を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上である被膜形成性高分子化合物、及び(B)保湿剤を含有するバック化粧料を、皮膚に塗布して就寝し、起床後、洗い流して使用するバック方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、長時間にわたって肌に水分を持続的に与えることができ、保湿効果の高いバック化粧料に関する。

【0002】

【従来の技術】顔や体の皮膚にうるおいを与えたり、有効成分を浸透させる目的で一時的に肌に適用するバック化粧料が種々実用化されている。それらバック化粧料としては、被膜を形成させて約30分後にその被膜をはがすピールオフタイプ、あるいは化粧料を厚めに塗布して、5～10分後に拭き取るもしくは洗い流すタイプのものが知られている。これらのバック化粧料は、いずれも肌に対する効果はある程度達成されるものの、塗布中にべたべたする、安静にしていないとバック剤が他のものについてしまうなど、使用中のわずらわしさが多かった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、使用中のわずらわしさがなく、肌に水分を持続的に与えることができ、保湿効果の高いバック化粧料を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、特定の高分子化合物と保湿剤を含有するバック化粧料を、皮膚に塗布してうすい被膜を形成させ、睡眠した後、洗い流せば、使用中のわずらわしさがなく、睡眠中に肌に水分を持続的に与え続けることができ、高い保湿効果が得られることを見出した。

【0005】すなわち、本発明は、(A) 水中に1重量%配合した液を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上である被膜形成性高分子化合物、及び(B)保湿剤を含有するバック化粧料を提供するものである。

【0006】また、本発明は、(A) 水中に1重量%配

合した液を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上である被膜形成性高分子化合物、及び(B)保湿剤を含有するバック化粧料を、皮膚に塗布して就寝し、起床後、洗い流して使用するバック方法を提供するものである。

【0007】

【発明の実施の形態】本発明で用いる成分(A)の高分子化合物は、以下に例示するようなものであり、その形態は塗工により被膜を形成するものであれば特に制限されず、水溶液、エマルジョン、有機溶剤溶液のいずれでも良い。水溶性高分子化合物としては、例えばカルボキシビニルポリマー、 κ -カラギーナン、 ι -カラギーナン、 λ -カラギーナン、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ローカストビーンガム、ヒアルロン酸ナトリウム、寒天、カルボキシメチルキチン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、特開平9-235301号に記載の水性高分子、特開昭64-10997号に記載の酸性多糖類、アラビアガム、グアーガム、トラガントガム、澱粉、デキストリン、アルギン酸、アルギン酸塩、ペクチン、デキストラン、プルラン、ゼラチン、キチン、ポリアクリル酸、コラーゲン、カチオン化セルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、マンナン、ガラクトン、クインシード、カゼイン、アルブミン、ポリビニルメチルエーテル、カルボキシメチルデンプン、メチルデンプン、アルギン酸プロピレングリコール、サクシノグルカン、カードラン等が挙げられる。

【0008】また、被膜形成性のエマルジョンとしては、キトサンプルランエマルジョン、アクリル酸アルキル共重合エマルジョン、アクリル酸アルキル・スチレン共重合エマルジョン、ビニルピロリドン・スチレン共重合エマルジョン、架橋型メチルポリシロキサン含有エマルジョン、メチルポリシロキサンエマルジョン等が挙げられる。非水溶性の高分子化合物としては、N-アシルポリエチレンイミン・メチルポリシロキサン共重合体、架橋型メチルポリシロキサン、高重合メチルポリシロキサン等が挙げられる。

【0009】これらの高分子化合物は、1種以上を用いることができるが、本発明においては、水中に当該高分子化合物を1重量%(2種以上併用の場合はその合計)配合した液(水溶液及び水分散液を含む)を、解放系で64時間、25℃、相対湿度50%の条件下に放置したとき、水分保持率が15%以上、好ましくは17.5%以上となるものであることが必要である。ここで、水分保持率は、前記のゲル40gを直径9cmのシャーレに入れ、前記条件で64時間放置した後、ゲルの重量を測定し、下記式により求める。

【0010】

【数1】

水分保持率(%) =

$$\frac{64\text{時間後の組成物の重量}-\text{添加した高分子化合物の重量}(0.4\text{g})}{\text{添加した水の重量}(39.6\text{g})} \times 100$$

【0011】成分(A)としては、水溶性高分子が好ましく、特にカルボキシビニルポリマーとカラギーナンを組合わせて用いるのが好ましい。

【0012】成分(A)の高分子化合物は、全組成中に0.05～6重量%、特に0.1～5重量%、更に0.2～4重量%配合するのが、べたべたせず、使用中のわずらわしさが生じずに被膜を形成できるので好ましい。

【0013】本発明で用いる成分(B)の保湿剤としては、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール等の多価アルコール；炭水素類、動植物油、エステル油、高級脂肪酸、高級アルコール、リン脂質、スフィンゴシン誘導体等の油剤；その他、アミノ酸及びその塩、アミノ酸誘導体及びその塩、ヒドロキシ酸及びその塩、ペタイン類、糖類、糖アルコール類、アンモニア、グルコサミン、クレアチン、尿素、特開平8-92054号に記載のグアニジン誘導体又はその酸付加塩、特開平10-87422号に記載のアミド誘導体、天然保湿因子(NMF)として知られた親水性吸湿物質又はそれらの誘導体などが挙げられる。

【0014】これらの保湿剤は1種以上を用いることができ、全組成中に0.001～50重量%、特に0.1～50重量%、更に0.5～50重量%配合するのが好ましい。

【0015】更に、本発明のバック化粧品には、前記成分のほか、通常の化粧品に用いられる成分、例えば界面

活性剤、ワックス類、シリコン類、ステロール類、粉体、低級アルコール、抗炎症剤、一重項酸素消去剤又は抗酸化剤、pH調整剤、無機塩、粘度調整剤、キレート剤、防腐剤、色素、美白成分、細胞賦活剤、紫外線吸収剤、ビタミン類、皮脂抑制剤、皮脂分泌促進剤、薬効成分、香料等を適宜配合でき、常法により製造できる。

【0016】本発明のバック化粧品は、皮膚に塗布するとうすい被膜が形成され、この被膜は肌に水分を持続的に与え、しかも容易に洗い流すことができる。従って、皮膚に塗布して就寝し、起床後、洗い流して使用することができ、例えば夜眠る前に皮膚に塗布して睡眠し、翌朝洗い流すという簡単な方法で、使用中のわずらわしさが全くなく、皮膚に水分を睡眠中(6時間以上)持続的に与え、高い保湿効果が得られる。

【0017】

【発明の効果】本発明のバック化粧品は、使用中のわずらわしさがなく、長時間にわたって肌に水分を持続的に与え、高い保湿効果が得られる。

【0018】

【実施例】参考例1

表1に示す成分をそれぞれ混合し、前記の方法により、その水分保持率を求めた。結果を表1に併せて示す。

【0019】

【表1】

成分(重量%)	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
カルボキシビニルポリマー(カーボポール940、ビー・エフ・グッドリッチ社製)	0.77	0.8	1.00	—	—
κ-カラギーナン(ソアギーナMV101、MRCポリサッカライド社製)	0.23	0.1	—	1.00	—
ポリビニルアルコール(ゴセノールEG30、日本合成化学工業社製)	—	—	—	—	1.00
N-プロピオニルポリエチレンイミン・メチルポリシロキサン共重合体	—	0.1	—	—	—
精製水	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
水分保持率(%)	20.42	19.50	12.00	14.00	4.20

【0020】実施例1

表3に示す組成のバック化粧品を常法により製造した。これらのバック化粧品を、0.5g手にとり、顔全体にひろげるように塗布し、軽くなじませるようにして、そのまま就寝後、翌朝における保湿効果、洗い流しやすさを10名の専門パネラーにより官能評価した。評価基準は表2の通りである。結果を表3に示す。

【0021】

【表2】

(評価基準)

【0022】

【表3】

	保湿効果	洗い流しやすさ
○	しっとりするとしたパネラーが7～10名	洗い流しやすいとしたパネラーが7～10名
△	しっとりするとしたパネラーが4～6名	洗い流しやすいとしたパネラーが4～6名
×	しっとりするとしたパネラーが3名以下	洗い流しやすいとしたパネラーが3名以下

成分(重量%)	本発明品		比較品	
	1	2	1	2
カルボキシビニルポリマー(カーボポール940、B. F. グッドリッチ社製)	1.00	1.00	1.00	—
κ-カラギーナン(ソアギーナMV101、MRCポリサッカライド社製)	0.30	0.30	—	—
N-プロピオニルポリエチレンイミン・メチルポリシロキサン共重合体	—	0.50	—	—
ポリビニルアルコール(ゴーセノールBG30、日本合成化学工業社製)	—	—	—	15.00
水酸化カリウム	0.40	0.40	0.40	0.40
グリセリン	5.00	5.00	5.00	5.00
1, 3-ブチレングリコール	5.00	—	5.00	5.00
ジカプリン酸ネオペンチルグリコール	—	1.00	—	—
スクワラン	—	1.00	—	—
ジメチルポリシロキサン(6mm ² /s)	4.00	4.00	4.00	4.00
ポリオキシエチレン(20E.O.)イソセチルエーテル	1.00	1.00	1.00	1.00
防腐剤	0.20	0.20	0.20	0.20
エタノール	5.00	5.00	5.00	5.00
香料	微量	微量	微量	微量
精製水	残部	残部	残部	残部
保湿効果	○	○	△	△
洗い流しやすさ	○	○	○	×

【0023】実施例2

【表4】

以下に示す組成のバック化粧料を常法により製造した。

(成分)	(重量%)
カルボキシビニルポリマー	
(カーボポール980、B.F.グッドリッチ社製)	0.8
κ-カラギーナン	
(ソアギーナMV101、MRCポリサッカライド社製)	0.2
水酸化カリウム	0.35
酸性多糖類(特開平1-213213号の実施例2に記載のもの)	0.1
ヒアルロン酸ナトリウム	0.1
グリセリン	10.0
ポリエチレングリコール	5.0
スクワラン	1.0
アミド誘導体(特開平10-87422号の実施例1に記載のもの)	1.0
ポリオキシエチレン(60E.O.)硬化ヒマシ油	1.0
防腐剤	0.2
精製水	残部

【0024】実施例3

【表5】

以下に示す組成のバック化粧料を常法により製造した。

(成分)	(重量%)
------	-------

カルボキシビニルポリマー (カーボボール940)	0.8
α-カラギーナン (ソアギーナMV101)	0.2
アミド誘導体 (特開平10-87422号の実施例1に記載のもの)	0.5
グアニジン誘導体のコハク酸塩 (特開平8-92054号の実施例1に記載のもの)	1.5
グリセリン	5.0
1,3-ブチレングリコール	5.0
水酸化カリウム	0.3
メチルポリシロキサン	4.0
ポリオキシエチレン(60E.O.)硬化ヒマシ油	1.0
エタノール	5.0
N-プロピオニルポリエチレンイミン・メチルポリシロキサン共重合体 (エタノール溶液)	0.5
防腐剤	0.2
エデト酸二ナトリウム	0.05
香料	微量
精製水	残部

【0025】実施例4

【表6】

以下に示す組成のパック化粧料を常法により製造した。

(成分)	(重量%)
カルボキシビニルポリマー (カーボボール941、B.F.グッドリッチ社製)	0.8
α-カラギーナン (ソアギーナMV101)	0.3
ポリビニルピロリドン	0.5
アルギニン	0.3
水酸化カリウム	0.35
コラーゲン	0.1
グリセリン	10.0
ポリオキシエチレンメチルグルコシド	5.0
架橋型メチルポリシロキサン	1.0
ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 (SH3775M、東レ・ダウコーニング社製)	0.5
テトラヒドロキシベンゾフェノン	0.1
黄色4号	0.003
防腐剤	0.2
精製水	残部

【0026】実施例2～4で得られたパック化粧料を、顔に塗布して睡眠(6時間)した後、洗い流した。使用

中のわずらわしさは全くなく、睡眠中肌に水分が持続的に与えられ、高い保湿効果が得られた。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4C083 AB032 AB051 AC022 AC102
AC122 AC182 AC212 AC352
AC432 AC532 AC582 AC642
AC742 AC852 AD011 AD042
AD072 AD091 AD092 AD112
AD152 AD172 AD202 AD212
AD332 AD351 AD352 AD432
BB51 CC01 CC07 DD23 DD31
EE12